



UVAPRINT HPV

Unité UV hautes performances

Propriétés du système

- Sécheurs UV hautes performances compacts
- Deux niveaux de puissance (1 kW et 2 kW)
- Régulation de puissance 50 %/100 %
- Puissance jusqu'à 200 W/cm
- Tous les spectres standard et beaucoup de spectres spéciaux disponibles
- Température de substrat basse

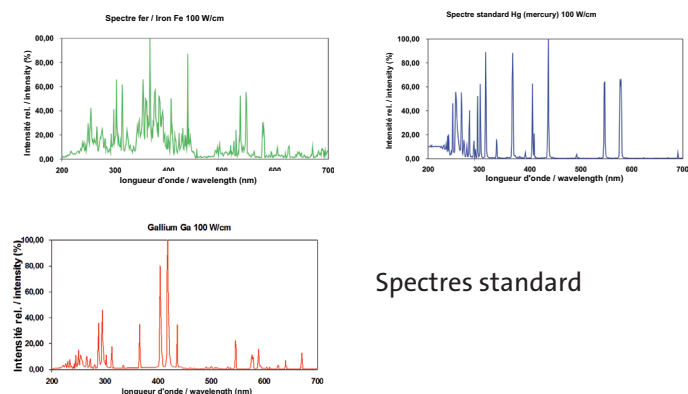
Avantages

- Intégration possible dans quasiment tous les processus de fabrication
- Efficacité élevée pour une vitesse maximale de production
- Facile à entretenir grâce à la construction modulaire
- Intégration facile grâce à « Plug & Play »

Unité UV hautes performances

L'unité UV compacte hautes performances avec géométrie des réflecteurs optimisée par CAO permet d'obtenir une **intensité d'UV maximale** par rapport à la puissance absorbée. La **simplicité du changement de lampe** permet d'adapter les spectres et les longueurs d'arc aux différentes applications. Le module UVAPRINT HPV est utilisé pour le durcissement des colles, masses de scellement, matières plastiques, peintures et vernis réagissant aux UV.

Le « Plug & Play » facilite l'installation. La tension d'alimentation s'élève, pour les deux niveaux de puissance (1 kW et 2 kW), à 230 V pour 50 Hz.



Spectres standard

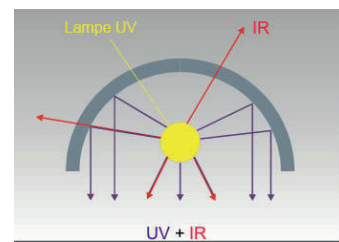
Élément de commande et alimentation en énergie

- Régulation de puissance à deux niveaux 50 %/100 % avec une puissance d'arc de :
 - 100 W/cm/200 W/cm pour une longueur d'arc de 100 mm
 - 66 W/cm/133 W/cm pour une longueur d'arc de 150 mm
 - 50 W/cm/100 W/cm pour une longueur d'arc de 200 mm
- Interface pour l'activation externe du volet occulteur et la commutation des niveaux 1 kW/2 kW
- Signaux externes « Lamp Error » et « Shutter open/close »
- En option télécommande ou télécommande avec minuterie
- Dimensions (L x l x H): 400 x 250 x 634 mm

Réflecteurs en option

Réflecteur dichroïque

- Réduction du rayonnement infrarouge d'env. 40 %
- Réduction de l'augmentation de température sur le substrat de jusqu'à 30 %
- Equipement ultérieur possible

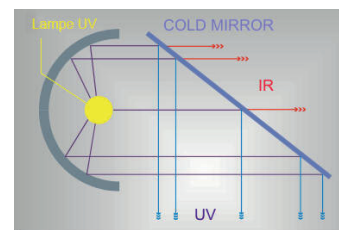


Unité de lampe

- Lampe UV hautes performances avec longueurs d'arc de 100, 150 et 200 mm
- Géométrie des réflecteurs optimisée par CAO
- Ventilateurs intégrés dans l'unité de lampe
- Au choix : volet occulteur avec entraînement électrique ou pneumatique, ou bien sans volet occulteur
- Système Advanced Cold Mirror ACM pour la réduction de température en option
- Réflecteurs dichroïques en option
- Contre-plaque de refroidissement en option

Advanced Cold Mirror (ACM)

- Réduction du rayonnement infrarouge de jusqu'à 85 %
- Réduction de l'augmentation de température sur le substrat de jusqu'à 65 %
- Equipement ultérieur possible



hönle group		Durcir	Séchage	Coller	Sceller	Mesurer
eleco panacol-efd		eltosch grafix	gepa coating	hönle	panacol	printconcept
		raesch	uv-technik speziallampen			



Dr. Höhle AG UV Technology, Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München, Germany
Téléphone : +49 89 85608-0, Fax : +49 89 85608-148. www.hoenle.de

Toutes les indications techniques et relatives aux processus dépendent de l'application et peuvent différer des données mentionnées dans ce document. Sous réserve de modifications techniques. © Copyright Dr. Höhle AG. Version 04/20